

外為令別表の7の項、省令第19条第1項～第5項

提供技術名	
メーカー名	

CISTEC 2024.09.08
(令和6年9月8日施行省令等対応)

質問事項	回答(注1)		備考
提供技術は <input type="checkbox"/> 技術(プログラムを除く。)は→1. 及び2. へ <input type="checkbox"/> プログラムは→3. へ 選択した項目の□に✓をマークし、下記の質問に回答のこと。			(注2)
[省令第19条第1項及び第3項の技術] <input type="checkbox"/> 1. 次のいずれかに該当するもの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)か? (1) 省令第6条第二号ハ(一)5若しくは6若しくは(二)3に該当するモノリシックマイクロ波集積回路増幅器、同条第二号ニ(一)5若しくは6若しくは(二)3若しくは4に該当するマイクロ波用ディスクリートトランジスタ、又は同条第十六号ロに該当する原子周波数標準器(外7項(1)、省令第19条第1項第一号) (2) 省令第6条に該当するもの(同条第二号ハ(一)5若しくは6若しくは(二)3若しくはニ(一)5若しくは6若しくは(二)3若しくは4又は第十六号ロに該当するものを除く。)(外7項(1)、省令第19条第1項第二号)	<input type="checkbox"/> いいえ ↓ <input type="checkbox"/> いいえ ←1. (3)へ	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> はい 省令第6条第__号()	「付表技術1」(注3) 省令第6条第二号ハ(一)5等左記の貨物は「告示貨物」(注4)
【はいと答えた場合、次の間に回答のこと】 ・次のいずれかに該当するもの設計又は製造に係る技術(プログラムを除く)か? <input type="checkbox"/> 省令第6条第二号に該当するマイクロ波用機器又はミリ波用機器の部分品のうち窒化ガリウム(GaN)を用いた基板又は窒化ガリウムのエピタキシャル層を有する基板を使用したもの <input type="checkbox"/> 省令第6条第一号カ、第十七号へ(四)若しくはルからフまで又は第十七号のニ又は第十七号の四のいずれかに該当するもの <input type="checkbox"/> 省令第6条第十八号、二十二号、二十三号、二十四号に該当する窒化ガリウム(GaN)を用いた基板(注:エピタキシャル/非エピタキシャル層のみに窒化ガリウムを含む基板は対象としない) ・次のいずれかの除外規定に該当するか? <input type="checkbox"/> イ: 省令第6条第十六号のニに該当するもの製造に必要な技術か? <input type="checkbox"/> ロ: 省令第6条第一号ハからルまでのいずれかに該当する集積回路のうち、次の(一)および(二)に該当する設計又は製造に必要な技術か? <input type="checkbox"/> (一): 最小線幅が0.130マイクロメートル以上のもの <input type="checkbox"/> (二): 多層構造を有するもの(金属層が3層以下のものに限る。) <input type="checkbox"/> ハ: プロセスデザインキット(省令第6条第一号から第八号の四までのいずれかに該当する貨物に係る機能又は技術を実装するライブラリが含まれているものを除く。)か? (3) マイクロプロセッサ、マイクロコンピュータ又はマイクロコントローラのコアであって、論理演算ユニットのアクセス幅のビット数が32以上のものか? ・次のいずれかに該当するもの設計又は製造に必要な技術か? イ: ベクトル演算器であって、浮動小数点ベクトル演算処理を同時に2を超えて実現できるように設計したもの ロ: 64ビット以上の浮動小数点演算処理を1サイクル当たり4を超えて実現できるように設計したもの ハ: 16ビットの固定小数点積和演算処理を1サイクル当たり8を超えて実現できるように設計したもの(外7項(3)、省令第19条第3項第三号)	<input type="checkbox"/> はい ↓ <input type="checkbox"/> はい (規制除外される) ↓	<input type="checkbox"/> はい ↓ <input type="checkbox"/> いいえ (規制除外されない) ←3. へ(プログラムを含む場合) ←【判定】欄へ(技術のみの場合)	「付表技術2」(注3) 最小線幅 (_____ μm) 金属層 (_____ 層) (注5) ビット数 (_____ ビット) (注6) 浮動小数点ベクトル演算処理数(注7、8) (_____) 浮動小数点演算処理数(注9) (_____ /サイクル) 固定小数点積和演算処理数(注10、11) (_____ /サイクル)
↓ 【イ、ロ、ハのいずれかに「はい」と答えた場合、次の間に回答のこと】 ・貨物等省令第19条第3項第三号中の技術において、役務通達 7の項(注12)の確認を行う。 ・確認の結果、「はい」の場合「規制除外される」、「いいえ」の場合「規制除外されない」。(役務通達 7の項)	<input type="checkbox"/> はい (規制除外される) ↓	<input type="checkbox"/> いいえ (規制除外されない) ↓	(注12) 最小線幅 (_____ μm) 金属層 (_____ 層)

外為令別表の7の項、省令第19条第1項～第5項

質問事項	回答(注1)		備考
<p>(4) 直径300ミリのシリコンウエハーであって、外周の除外領域を2ミリメートル以下としたウエハーの表面に対するスライス、研削及び研磨の技術のうち、長さ26ミリメートル、幅8ミリメートルの長方形に分割されたいずれの領域における平坦度が20ナノメートル以下を達成するために必要な技術 (外7項(3)、省令第19条第3項第五号)</p> <p>(5) ゲートオールアラウンド電界効果トランジスタ(GAAFET)の構造を有する集積回路又は半導体素子の設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)か? ・次のいずれかの除外規定に該当するか? <input type="checkbox"/> イ: プロセスデザインキット(第六条第一号から第八号の四までのいずれかに該当する貨物に係る機能又は技術を実装するライブラリが含まれているものを除く。) <input type="checkbox"/> ロ: ツールの認定又は保守に用いるもの (外7項(3)、省令第19条第3項第八号)</p>	<input type="checkbox"/> いいえ ↓	<input type="checkbox"/> はい ↓	(注13)
<p>[省令第19条第3項、第4項及び第5項の技術] <input type="checkbox"/> 2. 次のいずれかに該当するもの設計又は製造に係る技術(プログラムを除く。)か?</p> <p>(1) 絶縁体が二酸化けい素からなる集積回路のSOI基板(シリコンオンインシュレータ構造を有する集積回路の基板) (外7項(3)、省令第19条第3項第二号)</p> <p>(2) 超電導材料を用いた電子素子 (外7項(4)、省令第19条第4項)</p> <p>(3) 真空マイクロエレクトロニクス装置 (外7項(5)、省令第19条第5項第二号)</p> <p>(4) ヘテロ接合の半導体素子(動作周波数が31.8ギガヘルツ未満の高電子移動度トランジスタ又はヘテロ接合バイポーラトランジスタを除く。) (外7項(5)、省令第19条第5項第三号)</p> <p>(5) ダイヤモンド、炭化けい素又は酸化ガリウムを用いた電子機器の部分品として用いる基板 (外7項(5)、省令第19条第5項第四号)</p> <p>(6) 動作周波数が31.8ギガヘルツ以上の真空電子デバイス(クライストロン、進行波管、これらから派生したものを含む。) (外7項(5)、省令第19条第5項第五号)</p>	<input type="checkbox"/> いいえ ↓	<input type="checkbox"/> はい ↓	「付表技術2」(注3) (注14、15)
<p>[省令第19条第1項、第2項及び第3項のプログラム] <input type="checkbox"/> 3. 次のいずれかに該当するプログラムか?</p> <p>(1) 省令第6条第十六号ロに該当する原子周波数標準器を設計し、又は製造するために設計したプログラム (外7項(1)、省令第19条第1項第三号)</p> <p>(2) 省令第6条第十六号の二に該当するスプレー冷却方式の熱制御装置を設計するために設計したプログラム (外7項(1)、省令第19条第1項第四号)</p> <p>(3) 省令第6条に該当するもの(上記(1)及び(2)に該当するもの又は省令第6条第一号若しくは第十八号から第二十四号までのいずれかに該当するものを除く。)を設計し、又は製造するために設計したプログラム (外7項(1)、省令第19条第1項第五号)</p>	<input type="checkbox"/> いいえ ↓	<input type="checkbox"/> はい ↓ 省令第6条第__号()	「付表技術1」(注3) 省令第6条第十六号ロは「告示貨物」(注4)
<p>【はいと答えた場合、次の間に回答のこと】 ・次のいずれかに該当するもの設計又は製造に係るプログラムか? <input type="checkbox"/> 省令第6条第二号に該当するマイクロ波用機器又はミリ波用機器の部分品のうち窒化ガリウム(GaN)を用いた基板又は窒化ガリウムのエピタキシャル層を有する基板を使用したもの <input type="checkbox"/> 省令第6条第十七号へ(四)若しくはルからフまで、第十七号の二又は第十七号の四のいずれかに該当するもの</p> <p>(4) 省令第6条第十七号イ、ロ、ホ、へ又はヌからフのいずれかに該当するものを使用するために設計したプログラム (外7項(2)、省令第19条第2項)</p>	<input type="checkbox"/> いいえ ↓	<input type="checkbox"/> はい ↓	「付表技術2」(注3)
<p>【はいと答えた場合、次の間に回答のこと】 ・省令第6条第十七号へ(四)又はルからフまでのいずれかに該当するものを使用するために設計したプログラムか?</p>	<input type="checkbox"/> いいえ ↓	<input type="checkbox"/> はい ↓	「付表技術2」(注3)

外為令別表の7の項、省令第19条第1項～第5項

質問事項	回答(注1)		備考
(5)3. (1)～(3)のいずれかが「はい」か?	<input type="checkbox"/> いいえ ↓	<input type="checkbox"/> はい ←【判定】欄へ	
(6) 極端紫外を用いて集積回路を製造するための装置用のマスク又はレチクルのパターンを設計するために特に設計したコンピューショナル・リソグラフィ・プログラム (外7項(3)、省令第19条第3項第一号)	<input type="checkbox"/> いいえ ↓	<input type="checkbox"/> はい ↓	(注18、19)
(7) 電磁パルス又は静電放電による中断から1ミリ秒以内に動作の連続性を失うことなくマイクロコンピュータ又はマイクプロセッサを正常状態に回復するように特に設計したプログラム (外7項(3)、省令第19条第3項第四号)	<input type="checkbox"/> いいえ ↓	<input type="checkbox"/> はい ↓	
(8) ゲートオールアラウンド電界効果トランジスタ(GAAFET)の構造を有する集積回路を設計するために特に設計したECADプログラムか? ・次のいずれかに該当するか? <input type="checkbox"/> イ:レジスタ転送レベル(RTL)をGDS II又はこれと同等のデータベースファイル形式に実装するために特に設計したもの <input type="checkbox"/> ロ:設計する集積回路内のデータ処理における消費電力又はデータを転送するまでに要する時間を最適化するために特に設計したもの (外7項(3)、省令第19条第3項第六号)	<input type="checkbox"/> いいえ ←3. (9)へ <input type="checkbox"/> いいえ ↓	<input type="checkbox"/> はい ↓ <input type="checkbox"/> はい ↓	
(9) 走査型電子顕微鏡により取得した画像からGDS II データ又はこれと同等の標準レイアウトデータを抽出し、当該データの層間位置合わせ機能を実行し、多層のGDS II データ又は回路のネットリストを生成するために設計したプログラム (外7項(3)、省令第19条第3項第七号)	<input type="checkbox"/> いいえ ←【判定】欄へ	<input type="checkbox"/> はい ←【判定】欄へ	「付表技術2」(注3)
【判定】以上の結果、省令第19条に該当するか?	<input type="checkbox"/> 非該当	<input type="checkbox"/> 該当	(注1)
該 当 項 番	① 外為令別表の7の項 () () () ② 貨物等省令の条項等の番号等 省令第19条第[]項()号() 省令第19条第[]項()号() 省令第19条第[]項()号() ([]及び()内に該当項番を記入する。)		

- (注1) 回答欄において、 枠で囲まれたものを除き、アンダーラインがついたものが一つでも右欄にチェックされた場合、当該の技術又はプログラムは該当と判定され、左欄のみにチェックされた場合は非該当と判定される。
- (注2) 「省令第19条に掲げる技術(プログラムを除く。)」には、半導体素子又は集積回路の設計のためのライブラリ、設計情報又は関連データを含む。
「省令第19条第3項に掲げる技術」は、省令第19条第1項に掲げる技術及び外為令別表の4の項の中欄に掲げる技術を除く。
「省令第19条第4項及び第5項に掲げる技術」は、省令第19条第1項に掲げる技術を除く。
- (注3) 「付表技術1」とは、「輸出許可・役務取引許可・特定記録媒体等輸出等許可申請に係る提出書類及び注意事項等について」(輸出注意事項24第18号)の別表2の付表1に該当するものをいう。
「付表技術2」とは、同通達の別表2の付表2に該当するものをいう。
- (注4) 「告示貨物」とは、「輸出貿易管理令別表第3の3の規定により経済産業大臣が定める貨物」(平成13年12月28日付け告示第758号)に該当するものをいう。
- (注5) 「プロセスデザインキット」とは、技術的及び製造上の制約に従い、特定の半導体プロセスを使用した、特定の半導体集積回路の設計に必要とされる設計活動やルールが保証された設計ツールであって、半導体製造者から提供されるものをいう。
- (注6) 「マイクロプロセッサ」には、マイクロコンピュータを除き、デジタルシグナルプロセッサ、デジタルアレイプロセッサ、デジタルコプロセッサ及び複数のチップから構成されたものであって、一緒に動作することによりマイクロプロセッサ機能を与えるように設計したチップセットを含む。
- (注7) 「ベクトル」とは、32ビット以上の一次元配列をいう。
- (注8) 「ベクトル演算器」とは、浮動小数点ベクトル演算を複数同時に実行する命令が組み込まれたプロセッサ要素であって、少なくとも一つのベクトル演算ロジックユニット及び32要素以上のベクトルレジスタを有するものをいう。
- (注9) 「浮動小数点」とは、IEEE-754で定めるものをいう。
- (注10) 「固定小数点」とは、整数部と小数部の双方からなる固定幅の実数であって、整数のみの形式を含まない。
- (注11) 「16ビットの固定小数点積和演算処理を1サイクル当たり8を超えて実現できるように設計したもの」とは、音声や画像などのアナログ情報をデジタル的に処理するものをいう。デジタルシグナルプロセッサともいう。

- (注12) 「貨物等省令第19条第3項第三号中の技術(プログラムを除く。)」は、役務通達 7の項により、拡張命令を通じてアナログ信号をデジタル的に処理するものの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)、又は最小線幅が0.13マイクロメートル以上、かつ、金属層が5層以下の多層構造を有するマイクロプロセッサ、マイクロコンピュータ若しくはマイクロコントローラのコアの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)に該当する技術を除く。
- (注13) 「平坦度」とは、最小二乗法により求められた全ての表面データ(領域における境界領域を含む。)について、基準表面からの最大偏差と最小偏差の範囲をいう。
- (注14) 「貨物等省令第19条第3項第八号に規定する技術」には、プロセスレシピ(特定のプロセスステップのための一連の条件及びパラメータをいう。)を含む。
- (注15) 「貨物等省令第19条第3項第八号に規定するツール」には、半導体素子、集積回路若しくは半導体物質の製造用の装置を含む。
- (注16) 「省令第19条第5項第三号中の半導体素子に掲げる技術(プログラムを除く。)」は、光デバイス(発光ダイオード(LED)、レーザー発振器、フォトダイオード、フォトトランジスタ、フォトカプラ、太陽電池セル、光導波路等)を除く。
- (注17) 「真空電子デバイス」とは、真空回路における電磁波の伝搬又は無線周波数空洞共振器を使用した電子ビームの相互作用を基礎とした電子デバイスをいう。
- (注18) 「極端紫外」とは、電磁波スペクトルの波長が5ナノメートルを超え、124ナノメートル未満のものをいう。
- (注19) 「コンピューテーショナル・リソグラフィ」とは、コンピュータモデルを使用して、様々なパターン、プロセス及びシステム条件においてリソグラフィプロセスの結像性能を予測、修正、最適化及び検証を行うことをいう。

検討の結果、以上のとおり相違ありません。

作成責任者: (作成年月日 _____ 年 _____ 月 _____ 日)
会社名 _____
所属・役職 _____
(フリガナ) (_____)
氏名 _____ 印
電話 _____